

第6回SPring-8先端利用技術ワークショップ/AichiSRシンクロトロン光利用者研究会 産業界におけるAichiSRとSPring-8の相補的活用

水素添加反応下での担持金属触媒の *in-situ* XAFS評価

株式会社 東レリサーチセンター

表面科学研究部



目次

•	背景
	水素添加反応による有機化合物合成
	水素添加反応と触媒
	酸化グラフェン
	Pd/酸化グラフェンを用いた触媒反応
٠	研究目的
•	実験手法(XAFS), 試料, 実験条件
•	実験結果
	液体下 <i>in-situ</i> XAFS (Pd <i>K</i> 端 XANES, EXAFS)
	(液体なし) <i>in-situ</i> XAFS (Pd <i>K</i> 端 XANES)
	TEM (粒子サイズ評価)
	XPS (C1s)
•	考察およびまとめ

- 謝辞
- 最後に ~放射光を用いた触媒評価について~

水素添加反応による有機化合物合成

水素添加反応

有機化合物に水素原子を 付加する還元反応

高付加価値を有する 様々な有機化合物を合成



特定の不飽和結合を還元 選択的な反応制御により多様な生成物



水素添加反応と触媒



製品のさらなる高品質化・低コスト化のため、 高収率・高選択性を有する触媒材料の開発が進められている





担体:活性炭,アルミナ,シリカ... 担持金属:パラジウム,白金,ロジウム,ニッケル...

金属粒子の表面積を高い状態で保持分離・回収・再利用が容易

酸化グラフェン

<u>酸化グラフェン (Graphene Oxide / GO)</u>

- ベンゼン環がつながった2次元構造(グラフェン)が 官能基などを含有
- グラファイトの機械的もしくは化学的剥離により作製
 → 製造コストが安価
- 理論比表面積が高い → 触媒担体として有望



Pd/GOを用いた水素添加反応





GOの酸化度により生成物の選択性を制御

その要因は?学術的にも興味深い系

TORAY Toray Research Center, Inc.

研究目的および試料

<u>目的</u>

Pd/GO触媒の系をモデルケースとし、金属触媒の 化学状態や担体との相互作用に着目。

<u>Pd K端in-situ XAFS評価</u>により、触媒の反応メカ ニズムや反応特性の差異に関する知見を得る。



試料ご提供:岡山大学 仁科勇太准教授

XAFS分析



実験条件 / 溶媒下での *in-situ* XAFS





Pd K端 XANES (Pd/GO O:10wt%)



Pd K端 FT-EXAFS (Pd/GO O:10wt%)



Pd K端 XANES (Pd/GO O:50wt%)



Pd K端 FT-EXAFS (Pd/GO O:50wt%)



液体下 in-situ XAFS結果 -Pd価数変化-

XANESスペクトルをもとに価数の時間変化をグラフ化



酸素含有量でPdの「価数の変わり易さ」が異なる

Pd/GO in-situ XAFS –溶媒なし-



FT-EXAFS 試料間比較



水素処理後Pd粒子のサイズ分布(TEM)



TORAY Toray Research Center, Inc.

担体の状態評価 XPS (C1s領域)



①···水素処理前
 ②···水素処理(30 min)後

③···水素処理(30 min)のち酸素処理(60 min)後

担体側の構造は水素/酸素ガスの処理過程で変化は認められない。



Pd/GO(O:10wt%)

- Pd²⁺成分が一時生成
- 粒子サイズ小



酸素官能基などの終端量少ない → Pd粒子と担体との結合が強く Pd酸化状態が安定となる可能性 Pd/GO(O:50wt%)

- 常時Pd⁰成分
- 粒子サイズ大



酸素官能基などの終端量多い → Pd粒子と担体との結合が弱く Pd金属状態が安定となる可能性

反応特性の違いの要因

・立体障害の有無 10%の方が少ない → 完全な還元可能

•Pdの化学状態 10%で担体酸素との相互作用 → Pd^{δ+}の可能性 解離吸着したH原子を手放しやすい → 反応性高い可能性 まとめ



グラフェンの酸化度は、触媒活性種であるPdの酸化還元挙動を制御していると考えられ、これらが、溶媒下での水素添加反応の生成物の選択性を制御している要因となっていると考えられた。



岡山大学 仁科勇太准教授,森本直樹様 共同研究(試料ご提供など)

JASRI 本間徹生博士,大渕博宣博士 放射光実験(SPring-8/2015A1719)

高エネ研 木村正雄教授,阿部仁准教授 仁谷浩明助教,丹羽尉博博士 放射光実験(高エネ研/共同研究)

(株)東レリサーチセンター 八尋惇平,藤田学,辻淳一